

申請書入力例: 装置開発室施設利用

「申請基本情報」入力例①

- 「氏名」と書かれた緑色のバーを選択し、提案代表者を記入してください。
- 詳しい操作方法是マニュアル「申請(詳細)」をご確認ください。

My Page Download PDF Save App. Submit App. Login Use

2020年度 装置開発室施設利用(前期)(随時) 申請

1. 申請基本情報(basic information) 2. 研究内容(details) 3. 組織(members) 4. 図表・別紙 (Fig., Table, PDF) 5. 確認事項等

提案代表者氏名 (Name of research representative) **氏名 (Name):**

受付番号

申請日

不正防止のための確認

提案代表者ならびに本提案における共同利用研究者は、共同利用研究の実施にあたり、

- 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
平成26年8月26日文科科学大臣決定
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf
- 「大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針」
平成27年1月20日改正
<https://www.nins.jp/site/rule/1024.html#b>
- 「大学共同利用機関法人自然 科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規定」
平成20年2月28日 自機規程第74号
<https://www.nins.jp/uploaded/attachment/1226.pdf>

を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令などを遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん及び盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサーシップ、二重投稿等）を行いません。

上記について誓約する場合は、チェックを入れてください。

「申請基本情報」入力例②

- 「不正防止のための確認」「安全ガイドラインの順守についての確認」「来所に関する注意事項の確認」の内容を確認し、同意する場合は「誓約します」にチェックを入れてください。

画面左上の「Save App.」ボタンをクリックすると作成中の申請書を保存することができます。

不正防止のための確認	<p>https://www.nins.jp/site/rule/1024.html#b</p> <p>3. 「大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規定」 平成20年2月28日 自機規程第74号 https://www.nins.jp/uploaded/attachment/1226.pdf</p> <p>を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令などを遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん及び盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサーシップ、二重投稿等）を行いません。</p> <p>上記について誓約する場合は、チェックを入れてください。</p> <p><input type="checkbox"/> 誓約します</p> <p>• Required field</p>	
安全ガイドラインの順守についての確認	<p>提案代表者ならびに本提案における共同利用研究者は、共同利用研究の実施にあたり、</p> <p>1. 「分子科学研究所安全ガイド」 https://www.ims.ac.jp/guide/safetyguide.pdf</p> <p>を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法など関連する法令を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。</p> <p>上記について誓約する場合は、チェックを入れてください。</p> <p><input type="checkbox"/> 誓約します</p> <p>• Required field</p>	
来所に関する注意事項の確認	<p>1. 共同利用研究者に大学院学生が含まれている場合、当該共同利用研究課題に参加すること及び研究所へ来所することについて、指導教員及び所属大学の了承を得ていること。また、採択後に大学院学生が来所する際も事前に指導教員の了承を得ること。</p> <p>2. 研究活動中又は移動中に発生した事故等により提案代表者又は共同利用研究者が傷害を被った場合は、所属機関又は提案代表者が責任を持って対応すること。</p> <p>3. 故意や過失により研究所の施設や設備等を含む自然科学研究機構の資産に損害を与え、研究所から弁償の請求があった場合は、所属機関、提案代表者又は共同利用研究者が責任を持って対応すること。</p> <p>4. その他、共同利用研究課題の実施にあたり、不測の事態が生じた場合は、所属機関、提案代表者及び共同利用研究者が責任を持って適切に対応すること。</p> <p>以上のことについて、提案代表者及び共同利用研究者が内容を理解し、確認が済んでいることについて誓約する場合はチェックを入れてください。</p> <p><input type="checkbox"/> 誓約します</p> <p>• Required field</p>	<p>共同利用研究に参加する大学院学生及び学部学生については、所属大学において学生教育研究災害傷害保険（学研災）及び学研災 付帯賠償責任保険（付帯賠償）に加入していることを確認しておくことが望ましい。</p>

※エラーの表示(Required field)は、必要項目の記入後、申請内容を保存すると非表示になります。

「申請基本情報」入力例③

- 「課題名」「利用方法」「期間区分」について入力してください。
- 「未選択」と表示された項目は、ドロップダウンリストから該当するものを選択してください。

My Page Download PDF Save App. Submit App. Login	
課題名	<p>[0 文字] > 単語 : 0</p> <input type="text"/> <p>• Required field</p> <p>全角50文字以内。</p>
利用方法	<p>製作依頼申請の際には、協力研究(ナノテクノロジープラットフォーム)から申請をお願いします。</p> <p>--未選択-- ドロップダウンリストから選択 ▼</p> <p>• Required field</p>
期間区分	<p>--未選択-- ▼ ドロップダウンリストから選択</p> <p>• Required field</p>

「申請基本情報」入力例④

- 「利用期間」「所属機関からの旅費支給について」「分子研の他の共同利用研究への申請」について入力してください。
- 「未選択」と表示された項目は、ドロップダウンリストから該当するものを選択してください。

利用期間	ドロップダウンリストから選択 から <small>• Required field</small>		「利用期間」について、空欄をクリックすると下のようなカレンダーがポップアップするのでご希望の日付を選択してください。
所属機関からの旅費支給について <small>「一部有」を選択した場合は下記を入力してください。 日帰りの場合は0泊としてください。 上記申請中</small>	--未選択-- ドロップダウンリストから選択 <small>• Required field</small> <input type="text"/> 泊を <input type="text"/> 回分 <small>負担できる</small>		旅費支給「一部有」の場合入力
分子研の他の共同利用研究への申請	<small>「無」を選択した場合は、当施設からの旅費支給を希望するかを選択してください。</small> --未選択-- ドロップダウンリストから選択 <small>• Required field</small> <input type="text"/>	ドロップダウンリストから選択	旅費支給「無」の場合入力
	<small>分子研の他の共同利用研究への申請がある場合は「有」を選択してください。 「有」の場合、項目と課題名を記述してください。</small> <input type="text"/>		分子研の他の共同利用研究への申請が「有」の場合入力

「研究内容」入力例①

- 「利用したい設備(メカトロニクス・セクション)」 「利用したい設備(エレクトロニクス・セクション)」について、利用を希望する設備にチェックを入れてください。

2020年度 装置開発室施設利用		申請
1. 申請基本情報(basic information) 2. 研究内容(details) 3. 組織(members) 4. 図表・別紙 (Fig., Table, PDF) 5. 確認事項等		
利用したい設備 (メカトロニクス・セクション)	<input type="checkbox"/> マシニングセンター (マキノ BN1-85) <input type="checkbox"/> NCフライス盤 (マキノ AEV-74) <input type="checkbox"/> CNC旋盤 (Mazak SQT100MY) <input type="checkbox"/> ワイヤー放電加工機 (ファナック α-C400iB) <input type="checkbox"/> 形彫NC放電加工機 (ソデック A35R) <input type="checkbox"/> 3D測定顕微鏡 (オリンパス STM6DF) <input type="checkbox"/> 走査型電子顕微鏡 (キーエンス VE-8800) <input type="checkbox"/> 非接触三次元測定装置 (三鷹 NH-3SP) <input type="checkbox"/> 原子間力顕微鏡 <input type="checkbox"/> 小型2源RFスパッタ装置(クライオバック RSP-4-RF3×2) <input type="checkbox"/> 一般工作機械 <input type="checkbox"/> CAD・CAMシステム	<p style="text-align: center;">複数の設備利用希望可</p> <p>装置開発室では、左記の設備を保有しています。 複数利用希望可能です。</p>
利用したい設備 (エレクトロニクス・セクション)	<input type="checkbox"/> プリント基板加工機 (ACCURATE A427A) <input type="checkbox"/> ネットワーク/スペクトラム/インピーダンス・アナライザ (アジレントテクノロジー 4396B) <input type="checkbox"/> ロジック・アナライザ (テクトロニクス TLA5201) <input type="checkbox"/> デジタル・オシロスコープ (レクロイ 6200A) <input type="checkbox"/> LCRメーター (NF ZM2353) <input type="checkbox"/> ファンクション・ジェネレータ (テクトロニクス AFG3251) <input type="checkbox"/> 直流電圧・電流源 (エーディーシー 6243)	<p style="text-align: center;">複数の設備利用希望可</p> <p>装置開発室では、左記の設備を保有しています。 複数利用希望可能です。</p>

「組織」入力例①

- 提案代表者、共同利用研究者及び実験補助者と、それぞれの来所日程を入力してください。
- 入力方法の詳細はマニュアル「申請(詳細)」をご確認ください。

My Page Download PDF Save App. Submit App. Login Use

2020年度 装置開発室施設利用(前期)(随時) 申請

1. 申請基本情報(basic information) 2. 研究内容(details) 3. 組織(members) 4. 図表・別紙 (Fig., Table, PDF) 5. 確認事項等

利用者情報入力

研究実験補助のために共同利用研究者及び実験補助者を登録してください

(来所日程については、[+]を押下すると入力欄が表示されます。必要に応じて適宜[+]を押下して入力欄を追加してください。日帰りの場合は0泊として入力して下さい。)

	氏名	所属機関	部局	職名		来所日程
提案代表者 remove	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/> 泊 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> 回
					+	
共同利用研究者 remove	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/> 泊 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> 回
					+	
実験補助者 remove	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/> 泊 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> 回
					+	

add row (共同利用研究者) add row (実験補助者)

mail to member(s) ※一時保存してからご利用ください。

合計 (Total) 0 名 (Members)

組織表ダウンロード

「図表・別紙」入力例①

- 図表・別紙を入力してください。
- 入力方法の詳細はマニュアル「申請(詳細)」をご覧ください。

My Page Download PDF Save App. Submit App. Login Us

2020年度 装置開発室施設利用(前期)(随時) 申請

1. 申請基本情報(basic information) 2. 研究内容(details) 3. 組織(members) 4. 図表・別紙 (Fig., Table, PDF) 5. 確認事項等

図表・別紙 (Fig., Table, PDF)

Image layout(size) 3 per page

--	Label	Title/Caption	File upload
<input type="button" value="remove"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="参照..."/> <input type="button" value="upload"/>

No Image

申請に関する問い合わせ

住 所：〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺本町字西郷中38
岡崎統合事務センター 国際研究協力課 共同利用係

T E L：0564-55-7133

MAIL：r7133@orion.ac.jp

<公募要項はこちらから>

・分子科学研究所⇒公募案内

https://www.ims.ac.jp/guide/application_requirements.html